

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【公表番号】特表2010-510093(P2010-510093A)

【公表日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2010-013

【出願番号】特願2009-537269(P2009-537269)

【国際特許分類】

B 4 1 C 1/02 (2006.01)

B 4 1 N 1/12 (2006.01)

【F I】

B 4 1 C 1/02

B 4 1 N 1/12

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月13日(2010.10.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

フレキソ印刷プレートの形成法であって、

マスターツールパターンを画定する複数のくぼみを有し、前記くぼみ内に溶剤が配置されたマスターツールの上へ高分子基材を配置することと、

前記溶剤を前記高分子基材中へ拡散させて、前記マスターパターンに対して補完的な基材レリーフパターンを形成することと、

前記基材レリーフパターンを硬化させて、フレキソ印刷プレートを形成することと、を含む、フレキソ印刷プレートの形成法。

【請求項2】

主表面及び前記主表面から離れるように突出するレリーフパターンを有する高分子基材を含む、フレキソ印刷プレートであって、前記レリーフパターンが、少なくとも20マイクロメートルの高さを有し、かつ、前記レリーフパターンが、15マイクロメートル以下の横方向の寸法を有する形状部を含む、フレキソ印刷プレート。

【請求項3】

フレキソ印刷プレートの形成法であって、

微細構造を有する剛性マスターツールを提供することと、

前記剛性マスターツールを用いて高分子基材上で前記微細構造を複製して、微細構造を複製した高分子ウェブマスターツールを形成することと、

前記微細構造を複製した高分子ウェブマスターツールを用いて第2高分子基材上で前記微細構造を複製して、微細構造を複製したフレキソ印刷プレートを形成することと、を含み、

前記微細構造が、10マイクロメートル以下の横方向の寸法を有する形状部を含み、

ダイヤモンド旋削によって、前記剛性マスターツール微細構造を形成することを更に含む、フレキソ印刷プレートの形成法。